

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成19年7月12日(2007.7.12)

【公表番号】特表2006-526890(P2006-526890A)

【公表日】平成18年11月24日(2006.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2006-046

【出願番号】特願2006-508236(P2006-508236)

【国際特許分類】

<i>H 05 K</i>	<i>3/18</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 05 K</i>	<i>3/40</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>C 25 D</i>	<i>7/00</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>C 25 D</i>	<i>5/18</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>C 25 D</i>	<i>21/18</i>	<i>(2006.01)</i>

【F I】

<i>H 05 K</i>	<i>3/18</i>	<i>G</i>
<i>H 05 K</i>	<i>3/40</i>	<i>K</i>
<i>C 25 D</i>	<i>7/00</i>	<i>J</i>
<i>C 25 D</i>	<i>5/18</i>	
<i>C 25 D</i>	<i>21/18</i>	<i>G</i>

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月23日(2007.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

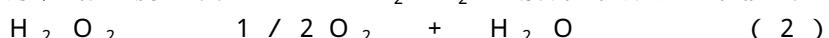
【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

一方、銅金属表面におけるH₂O₂の触媒的破壊は下記式に従って進行する。



この反応は、紫外線の照射によるH₂O₂の破壊よりもはるかに速い。

式(1)および式(2)に従ってH₂O₂が反応する割合は、それぞれ、温度、圧力、電解質の純度および触媒金属表面の性質といった要素に依存する。